

เทกซ์เจอร์ของของผสมไมมาติก-คอเลสเทอริกที่อุณหภูมิ
ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะ เมโซมอริก-ไอโซโทรปิก



นางวิมล เกรียงไกร

004766

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แผนกวิชาฟิสิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๐

i17369009

TEXTURES OF NEMATIC-CHOLESTERIC MIXTURES
NEAR THE MESOMORPHIC-ISOTROPIC TRANSITION TEMPERATURE

Mrs. Vimol Kriengkrai

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements
for the Degree of Master of Science

Department of Physics

Graduate School

Chulalongkorn University

1977

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาคามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

(Handwritten signature)

(ศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ)

คณบดี

คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

(Handwritten signature)ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เล็งหะพันธุ์)

(Handwritten signature)กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัง เมธาศิริ)

(Handwritten signature)กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธ์ เนาววิบูล)

(Handwritten signature)กรรมการ

(อาจารย์ ดร.อนันตสิน เตชะกำพูน)

อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย

อาจารย์ ดร.อนันตสิน เตชะกำพูน

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เทกซ์เจอร์ของของผสมนิมาติก-คอลลอยด์ที่อุณหภูมิ

ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซทรอปิก

โดย นางวิมล เกรียงไกร

แผนกวิชา ฟิสิกส์

หัวข้อวิทยานิพนธ์

เทกซ์เจอร์ของของผสมนิมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิ
ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก

ชื่อ

นางวิมล เกรียงไกร, แผนกวิชา ฟิสิกส์

ปีการศึกษา

๒๕๑๘

บทคัดย่อ



จากการสังเกตทางทัศนศาสตร์ของการ เกิดลวดลายของ เทกซ์เจอร์ของของผสมนิมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก

เราพบเทกซ์เจอร์ของผลึกเหลวซึ่งมีความหนา 25 ไมครอน และอยู่ระหว่างแผ่นแก้วคู่ขนานได้แก่ สไลด์กับโคเวอร์สลิป เป็นริ้วของอนุกรมของเส้นมืดเส้นสว่างมีลักษณะคล้ายลายพิมพ์นิ้วมือ เหมือนกับผลการวิจัยของ พี.อี.คลาสิค และ เอ็ม.คลีแมน ในปีค.ศ.1972

ถ้าไม่มีโคเวอร์สลิปลวดลายของเทกซ์เจอร์จะเป็นลายกันทอย ซึ่งยังไม่เคยปรากฏในผลการวิจัยอื่นเลย เทกซ์เจอร์ลายกันทอยประกอบด้วยวงของลายกันทอยเป็นจำนวนมาก

ลวดลายของเทกซ์เจอร์ทั้งสองของของผสมนิมาติก-คอเลสเทอริกที่ผสมกันโดยมีหรือไม่มีโหลอื่นซึ่งเป็นตัวหาคะลายไม่แตกต่างกัน โหลอื่นช่วยให้ลวดลายชัดเจนขึ้นเท่านั้น

เมื่อนำนักคิดเป็นร้อยละของคอเลสเทอริกเปลี่ยนไป ครั้งหนึ่งของขนาดของพิทซ์ของเทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือจะแปรเปลี่ยนอย่างเชิงเส้นกับส่วนกลับของนำนักคิดเป็นร้อยละของคอเลสเทอริก ซึ่งเหมือนกับผลการวิจัยก่อนๆ ขนาดของวงของลายกันทอยจะเล็กลงถ้านำนักคิดเป็นร้อยละของคอเลสเทอริกเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์อย่างชัดเจน

สำหรับแต่ละตัวอย่างของของผสมนิมาติก-คอเลสเทอริก อุณหภูมิที่จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก (T_{cmi}) ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ อย่างไรก็ดี T_{cmi} ไม่สูงเกินพิสัยของอุณหภูมิของการเป็นเมโซมอร์ฟิกของ MBBA ซึ่งเป็นผลึกเหลวชนิดนิมาติก

ที่ใช้ในการวิจัย

ที่อุณหภูมิในช่วงต่างๆซึ่งใกล้จุดเปลี่ยนสถานะ เมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก เราได้ศึกษาลวดลายของ เทกซ์เจอร์ ของของผสมนี้มาติก-คอเลสเทอริกในแสงโพลาไรซ์อย่างเชิงเส้น และแสงธรรมดา พบลวดลายเป็นริ้วยาวของเส้นคมชัด เราสรุปว่าเส้นคมชัดนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของคุณสมบัติทางทัศนศาสตร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเรียงตัวของระนาบของแกนของโมเลกุลที่อยู่ตรงบริเวณผิวสัมผัสของตัวอย่างของสารกับแผ่นแก้ว อาจกล่าวได้ว่าเส้นคมชัดคือคริสตัลเนชันแบบ X ที่ผิวของตัวอย่างของสาร

ที่อุณหภูมิใกล้ T_{cMI} มากๆกล่าวคือประมาณ $0.1^{\circ}C$ ก่อนถึง T_{cMI} เราได้ศึกษา เทกซ์เจอร์ ในแสงโพลาไรซ์อย่างเชิงเส้นและแสงธรรมดาเช่นกัน ลวดลายของ เทกซ์เจอร์ ของของผสมนี้มาติก-คอเลสเทอริกมีสีสรรต่างๆเกิดขึ้นเมื่อสังเกตในแสงโพลาไรซ์อย่างเชิงเส้น การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของสีที่บริเวณต่างๆของ เทกซ์เจอร์ จะแปรเปลี่ยนไปกับอุณหภูมิและทิศทางของแสงโพลาไรซ์ ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากระนาบของคอเลสเทอริกที่บริเวณดังกล่าวเข้ามาภายในตัวอย่างของสารมีทิศทางขนานกับแผ่นแก้ว แกนของโมเลกุลจึงบิดขนานกับแผ่นแก้ว เมื่อแสงโพลาไรซ์ซึ่งมีเวกเตอร์ทางไฟฟ้าขนานกับแผ่นแก้วผ่านตัวอย่างของสาร เวกเตอร์ทางไฟฟ้าจะบิดตัวไปตามวิถีของอีลิก

และเรายังพบการเปลี่ยนแปลงของพิทช์ของ เทกซ์เจอร์ ลายพิมพ์นิ้วมือไปกับอุณหภูมิด้วย แต่ยังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียด

Thesis Title Textures of Nematic-Cholesteric Mixtures
near the Mesomorphic-Isotropic Transition
Temperature

Name Mrs.Vimol Kriengkrai , Department of Physics

Academic Year 1976

Abstract

The textures of nematic-cholesteric mixtures near the mesomorphic-isotropic transition temperature were optically observed.

The texture of a liquid crystal 25 microns in thickness and held between parallel glass plates, slide and cover slip, was found to consist of the stripes of a series of dark and bright lines reminiscent of a finger-print as previously reported by P.É. Cladis and M. Kléman in 1972.

When the cover slip was removed , a remarkable appearance of the texture was found to be spiral hitherto unpublished elsewhere. The texture consists of several rings of spirals.

The remarkable appearances of the two textures of nematic-cholesteric mixtures are almost the same with or without the presence of toluene as the solvent, The presence of toluene merely resulted in a better optical contrast of the sample.

The percentage by weight of cholesteric was then varied. The half-pitch of the finger-print texture was confirmed to vary linearly with the reciprocal of the percentage by weight of cholesteric. The size of the rings in the spiral texture was also found to decrease as the percentage by weight of cholesteric increased, although no definite relationship was attempted.

The mesomorphic-isotropic transition temperature (TcMI) was different for a given mixture under different conditions. However the TcMI did not exceed the mesomorphic-range of MBBA which is the nematic liquid crystal used in the research.

At a number of intervals of temperature near TcMI, the remarkable appearances of textures of nematic-cholesteric mixtures were studied under the linearly polarized and ordinary light. Long stripes of sharp dark lines were observed in all of these cases. We concluded that these sharp dark lines were caused by an abrupt change in optical property which in turn was caused by an abrupt change of the orientation of the axis of molecules at the region of the contact surface between the sample and the glass plate. In other words, these sharp lines are χ disinclinations at the surface of the sample.

At temperature very close to TcMI within $\pm 0.1^\circ\text{C}$, the textures were similarly observed under the linearly polarized and ordinary light. The remarkable appearances of textures of nematic-cholesteric mixtures exhibited colour of different hues only when the linearly polarized light was used. The formation and change of colour in different regions of the texture varied with temperature, and the axis of the polarized light. The occurrence of this phenomenon could perhaps be explained by the orientation of the cholesteric plane near but not next to the glass plate as being parallel to the plate. The axis of the molecules probably twisted parallel to the glass plate. As the incident polarized light, whose electrical vector was initially parallel to the glass plate, traverses through the sample, the electrical vector will be twisted along the helical path.

The pitch of the finger-print texture was also found to vary with temperature, although no numerical analysis was attempted.

กิติกรรมประกาศ

ด้วยความช่วยเหลือโดยให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ มาตลอด
ของอาจารย์ ดร.อนันตสิน เตชะกำพูน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงสำเร็จลงได้ ข้าพเจ้าขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ คุณ ชีระยศ เอื้ออริยกุล นิสิตชั้นปีที่ 4
แผนกศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้ช่วยสร้างเครื่องมือบางอย่างที่ใช้ในการวิจัย



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
รายการตารางประกอบ	ง
รายการรูปประกอบ	ฉ
บทที่	



1. บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย	5
1.2 วิธีที่จะดำเนินการวิจัย	5
1.3 ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย	6
2. ทฤษฎี	7
2.1 ทฤษฎีความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์	7
2.1.1 ผลิตภัณฑ์นิคสเมคคิก	13
2.1.2 ผลิตภัณฑ์นิมาคิก	15
2.1.3 ผลิตภัณฑ์คอลลอสเตอริก	15
2.2 นิมาคิกซีเรนเทกซ์เจอร์	16
2.2.1 ที่มาของนิมาคิกซีเรนเทกซ์เจอร์	16
2.2.2 นิมาคิกซีเรนเทกซ์เจอร์ที่สังเคราะห์โดยโครสโพลารอยต์	19
2.3 เทกซ์เจอร์ของคอลลอสเตอริก	21
2.3.1 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือ	21
2.3.2 แบบจำลองอย่างง่าย ๆ	22
3. วิธีทำการวิจัย	32
3.1 อุปกรณ์	32
3.2 วัสดุ	34

3.3	การดำเนินการวิจัย	46
3.3.1	การเตรียมของผสมมีมาติก-คอเลสเทอริก MBBA/CA, MBBA/CN และ MBBA/CP	46
3.3.2	วิธีทำความสะอาดสไลด์กับโคเวอ์สลิป	47
3.3.3	การเตรียมสไลด์ของของผสมมีมาติก-คอเลสเทอริก	47
3.3.4	ศึกษาเท็กซ์เจอร์ของของผสมมีมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิ ใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก	49
4.	ผลการวิจัย	51
4.1	เท็กซ์เจอร์ของของผสมมีมาติก-คอเลสเทอริก ที่ผสมโดยตรงกับที่ผสม โดยอาศัยโพลีอินที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก .51	51
4.2	เท็กซ์เจอร์ของสไลด์ต่างๆของตัวอย่างของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก53.	53
4.3	เท็กซ์เจอร์ของ MBBA/CA $0.391 \pm 0.012\%$, $0.8591 \pm 0.0001\%$ และ $1.99 \pm 0.02\%$ ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก- ไอโซโทรปิก	56
4.4	เท็กซ์เจอร์ของ MBBA/CN $0.398 \pm 0.003\%$, $1.061 \pm 0.015\%$ และ $2.35 \pm 0.03\%$ ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก- ไอโซโทรปิก	60
4.5	เท็กซ์เจอร์ของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$, MBBA/CP $1.06 \pm 0.01\%$ และ MBBA/CP/Toluene $1.804 \pm 0.014\%$ ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสถานะเมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก63	63
4.6	อุณหภูมิที่จุดเปลี่ยนสถานะ	65
4.7	การเปลี่ยนแปลงของลวดลายของเท็กซ์เจอร์ของของผสมมีมาติก- คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิในช่วงต่างๆซึ่งใกล้จุดเปลี่ยนสถานะ เมโซมอร์ฟิก- ไอโซโทรปิก	69

4.7.1	เทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริกที่อุณหภูมิห่างจาก TcMI มาก	69
4.7.2	เทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิใกล้ TcMI มากๆ	74
4.8	การ เกิดคลื่นเรนเทกซ์เจอร์ของเทกซ์เจอร์ลายกันหยอกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น ของเหลวแบบไอโซโทรปิก	88
4.9	สเฟียรูไลท์ซึ่ง เกิดที่อุณหภูมิที่จุดเปลี่ยนสภาวะไอโซโทรปิก-เมโซมอร์ฟิก .	91
5.	การอธิบายผลการวิจัย	106
5.1	การ เกิดลวดลายของเทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสภาวะ เมโซมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิก	106
5.1.1	บทบาทของโพลีเมอร์ที่มีต่อเทกซ์เจอร์	106
5.1.2	เทกซ์เจอร์ของทุกสไลด์ของตัวอย่างของของผสมเนื้อมาติก- คอเลสเทอริกเดียวกัน	107
5.1.3	เทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริก ซึ่งมีร้อยละ โดยน้ำหนักของคอเลสเทอริกต่างกัน	108
5.1.4	เทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริก ซึ่งผลึกเหลว ชนิดคอเลสเทอริกเปลี่ยนเป็นชนิดต่างๆ	109
5.1.5	อุณหภูมิที่จุดเปลี่ยนสภาวะ	114
5.2	การ เปลี่ยนแปลงของลวดลายของเทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก- คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิในช่วงต่างๆซึ่งใกล้จุดเปลี่ยนสภาวะเมโซมอร์ฟิก- ไอโซโทรปิก	117
5.2.1	ลวดลายของเทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิห่างจาก TcMI มาก	117
5.2.2	ลวดลายของเทกซ์เจอร์ของของผสมเนื้อมาติก-คอเลสเทอริก ที่อุณหภูมิใกล้ TcMI มาก	121

บทที่	หน้า
5.3 ความแตกต่างระหว่างเทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือและเทกซ์เจอร์ลายก้นหอย ของของผสมนี้มาติก-คอเลสเทอริก	125
5.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับสเปกตรัมไลท์ของเทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือ	129
บรรณานุกรม	132
ประวัติการศึกษา	134

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
3-1 แสดงชื่อ, สูตร, การย่อและพิสัยของอุณหภูมิของการ เป็นเมโคมอร์ฟิกของสาร ที่ใช้	44
3-2 แสดงร้อยละโดยน้ำหนักของคอเลสเทอริกของของผสมเมีมาติก-คอเลสเทอริก ที่ใช้ในการทดลอง	48
4-1ก แสดงอุณหภูมิที่จุดเปลี่ยนสภาวะ เมโคมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิกและอุณหภูมิที่จุด เปลี่ยนสภาวะไอโซโทรปิก-เมโคมอร์ฟิกของ เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของของผสม ที่ใช้ในการทดลอง	66
4-1ข แสดงอุณหภูมิที่จุดเปลี่ยนสภาวะ เมโคมอร์ฟิก-ไอโซโทรปิกและอุณหภูมิที่จุด เปลี่ยนสภาวะไอโซโทรปิก-เมโคมอร์ฟิกของ เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ ของผสมที่ใช้ในการทดลอง	68
4-2 แสดงการวัดพิทซ์ที่เปลี่ยนไปจากรูปที่ 4-42 ถึง 4-45 เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 °ซ วัดตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง	82
5-1 แสดงขนาดของพิทซ์ของ เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของของผสมเมีมาติก- คอเลสเทอริกที่ใช้ในการทดลอง	110

รายการรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2-1 แสดงองค์ประกอบของความโค้ง "สเปล์ย์" \hat{L} ชนากับแกน z ที่อริจิน o เมื่อ x หรือ y มีค่าเพิ่มขึ้นทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลจะลู่ออก x . แสดงทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลซึ่งลู่ออกในระนาบ xz	9
2-2 แสดงองค์ประกอบของความโค้ง "ทวิสต์" \hat{L} ชนากับแกน z ที่อริจิน o เมื่อ x หรือ y มีค่าเพิ่มขึ้นทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลซึ่งอยู่ในระนาบ yz หรือระนาบ xz จะบิดจากตำแหน่งเดิมเป็นมุมต่างๆ x . แสดงทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลซึ่งปิดรอบแกน y ในระนาบ xz	10
2-3 แสดงองค์ประกอบของความโค้ง "เบนด์" \hat{L} ชนากับแกน z ที่อริจิน o เมื่อ z มีค่าเพิ่มขึ้นทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลจะโค้ง x . แสดงทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลในระนาบ xz ซึ่งโค้ง	11
2-4 แสดงทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุล \hat{L} ของผลึกเหลวชนิดสเมคติก x . ของผลึกเหลวชนิดนีมาติก	14
2-5 \hat{L} อยู่ในระนาบ xy ทำมุม ϕ กับแกน x	17
2-6 แสดงคิอสีนโคส เนชั่นสำหรับค่า n ต่างๆที่ไม่เท่ากับ $+2$ เมื่อ $\phi_0 = 0$, และสำหรับค่า n เท่ากับ $+2$ เมื่อ $\phi_0 = 0, \frac{\pi}{4}$ และ $\frac{\pi}{2}$	18
2-7 แสดงซลิเรนเท็กซ์เจอร์ของผลึกเหลวชนิดนีมาติกที่มี 2 และ 4 แฉก	19
2-8 แสดงทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุล \hat{L} ซึ่งทำมุม θ กับระนาบ xy	29
2-9 แสดงการเปลี่ยนของ θ เมื่อ x เปลี่ยนสำหรับค่า $z = 0, z \rightarrow \pm \frac{d}{2}$, และ $z = \pm \frac{d}{2}$	30
2-10 แสดง \mathcal{K} คิอสีนโคส เนชั่นอยู่ตรงบริเวณที่ทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลตั้งฉากกับระนาบของสาร	31
3-1 กล้องจุลทัศน์โอลิมปัสแบบซีเค	35
3-2 กล้องจุลทัศน์โอลิมปัสแบบซีเคแสดงทางเดินของแสง	36

รูปที่	หน้า
3-3 เครื่องคุมอุณหภูมิแบบเมทเลอร์ เอฟพี 5	37
3-4 กล้องคุมอุณหภูมิ เอฟพี 52 และแป้นบันทึก	38
3-5ก กล้องฉายรูปโอลิมปัสสำหรับกล้องจุลทัศน์แบบพีเอ็ม 6	38
3-5ข มาตรการวัดแสงโอลิมปัสแบบอีเอ็มเอ็ม-วี	39
3-6 กล้องจุลทัศน์และกล้องคุมอุณหภูมิที่สร้างขึ้นประกอด้วยแหล่งกำเนิดของแสง, แทน รองรับกล้องคุมอุณหภูมิ, เลนส์หน้ากล้องฉายรูปและกล้องจุลทัศน์ ระหว่างแหล่ง กำเนิดของแสงกับแทนรองรับกล้องคุมอุณหภูมิมิโปลาโร เซอร์และระหว่างแทนรองรับ กล้องคุมอุณหภูมิกับเลนส์มีแอนนาไลเซอร์ โปลาโร เซอร์กับแอนนาไลเซอร์ครอส กัน	40
3-7 กล้องคุมอุณหภูมิ ก.ฝาปิดแผ่นบน(มองค่านบนและค่านล่าง) 1.โคเวอร์สลิปบิก ของคูสไลต์ 2.ช่องคูสไลต์ ข.ที่วางสไลต์ 1.ช่องวางสไลต์ 2.ตำแหน่งของ ตัวอย่างของสารที่อยู่บนสไลต์ 3.ช่องใส่เทอร์มิสเตอร์ ค.ฐานใส่ตัวให้ความร้อน 1.บริเวณที่จะวางขลวคณิโครม ง.ลวคณิโครมพันรอบแผ่นไมกา จ.ฉนวนหุ้มทาง เดินของลวคณิโครม ฉ.เทอร์มิสเตอร์คิคอยู่ในแทน ข.เมื่อประกอบส่วนต่างๆเข้า เป็นกล้องคุมอุณหภูมิ	41
3-8 เครื่องวัดอุณหภูมิ ก.เทอร์มิสเตอร์ ข.เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1.แบคเตอร์ 9 โวลต์ 3 ก้อน 2.สวิทซ์ 2 ทางเลือก 9 โวลต์กับ 27 โวลต์ ค.มิลลิแอม มิเตอร์มีสเกลของอุณหภูมิที่สร้างบนสเกลของมิลลิแอมมิเตอร์	42
3-9 แหล่งกำเนิดของแสง ก.ภาคจ่ายไฟแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เป็นไฟฟ้า กระแสสลับ 9-12 โวลต์ 3 แอมแปร์ ข.ภาคเรกติไฟเออร์ ค.ภาคตัวกรอง ง.หลอดไฟ 7 โวลต์ จ.สเกลเป็นองศาอยู่ระหว่าง 50° - 0° - 50° ฉ.ทางเข้า ของไฟฟ้ากระแสตรง ช.แผ่นโพลารอยด์ทำหน้าที่เป็นโปลาโร เซอร์ ซ.แผ่น โพลารอยด์ทำหน้าที่เป็นแอนนาไลเซอร์	43
4-1 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CP/Toluene	0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 38.2°ซ

	ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 151
4-2	เท็กซ์เจอร์ของ MBBA/CP 1.06 ± 0.01% ที่อุณหภูมิ 40.3°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 152
4-3	เท็กซ์เจอร์ของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 36.8°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 252
4-4	เท็กซ์เจอร์ของ MBBA/CP 1.06 ± 0.01% ที่อุณหภูมิ 40.2°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 253
4-5	เท็กซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 33.8°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 1	54
4-6	เท็กซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 35.6°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 254
4-7	เท็กซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 33.5°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 355
4-8	เท็กซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 39.8°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 155
4-9	เท็กซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่อุณหภูมิ 38.3°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์ที่ 2	56
4-10	เท็กซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CA 0.391 ± 0.012% ที่อุณหภูมิ 38.8°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์57
4-11	เท็กซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CA 0.8591 ± 0.0001% ที่อุณหภูมิ 34.0°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์57

รูปที่

หน้า

4-12 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CA $1.99 \pm 0.02\%$ ที่อุณหภูมิ 39.5°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์58

4-13 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CA $0.391 \pm 0.012\%$ ที่อุณหภูมิ 39.2°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์58

4-14 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CA $0.8591 \pm 0.0001\%$ ที่อุณหภูมิ 42.8°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์59

4-15 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CA $1.99 \pm 0.02\%$ ที่อุณหภูมิ 39.6°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์59

4-16 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CN $0.398 \pm 0.003\%$ ที่อุณหภูมิ 40.2°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์60

4-17 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CN $1.061 \pm 0.015\%$ ที่อุณหภูมิ 35.4°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์61

4-18 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CN $2.35 \pm 0.03\%$ ที่อุณหภูมิ 34.2°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์61

4-19 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CN $0.398 \pm 0.003\%$ ที่อุณหภูมิ 40.2°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์62

4-20 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CN $1.061 \pm 0.015\%$ ที่อุณหภูมิ 39.2°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์62

4-21 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CN $2.35 \pm 0.03\%$ ที่อุณหภูมิ 38.8°C
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์63

4-22 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $1.804 \pm 0.014\%$ ที่
 อุณหภูมิ 36.0°C ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .64

4-23 เทกซ์เจอร์ลายกันรอยของ MBBA/CP/Toluene $1.804 \pm 0.014\%$ ที่
 อุณหภูมิ 36.3°C ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .64

รูปที่

4-24 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CA 0.391 ± 0.012% ที่อุณหภูมิ 39.2 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 โพลารอยด์ทำมุมกัน 0 องศา70

4-25 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CA 0.391 ± 0.012% ที่อุณหภูมิ 39.2 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 โพลารอยด์ทำมุมกัน 90 องศา70

4-26 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CA 0.391 ± 0.012% ที่อุณหภูมิ 39.2 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 ในคริสโพลารอยด์ เมื่อดูที่ตำแหน่ง 0
 องศา71

4-27 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CA 0.391 ± 0.012% ที่อุณหภูมิ 39.2 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 ในคริสโพลารอยด์ เมื่อดูที่มุมมาอยู่ที่
 ตำแหน่ง 90 องศา71

4-28 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CN 0.398 ± 0.003% ที่อุณหภูมิ 40.6 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 โพลารอยด์ทำมุมกัน 0 องศา72

4-29 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CN 0.398 ± 0.003% ที่อุณหภูมิ 40.6 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 โพลารอยด์ทำมุมกัน 90 องศา72

4-30 เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CN 0.398 ± 0.003% ที่อุณหภูมิ 40.6 °ซ ความหนา
 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 ไม่มีโพลาริเซอร์73

4-31 ซิงกูลาริตี 4 แฉก ของซลีเรนเทกซ์เจอร์ของ MBBA ที่อุณหภูมิ 44.5 °ซ ความ
 หนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 คริสโพลารอยด์73

4-32 ซิงกูลาริตีในรูปที่ 4-31 เห็นแต่จุดๆเดียวในแสงเมื่อไม่มีโพลาริเซอร์74

4-33 เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่
 อุณหภูมิ 35.9 °ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 โพลารอยด์ทำมุม
 กัน 0 องศา75

4-34 เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของ MBBA/CP/Toluene 0.589 ± 0.004% ที่
 อุณหภูมิ 35.9 °ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10×20 โพลารอยด์ทำมุม
 กัน 90 องศา76

รูปที่

หน้า

4-35 เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่
 อุณหภูมิ 35.9° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ไม่มีโพลาริเซอร์ 76

4-36 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่
 อุณหภูมิ 34.0° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 โพลารอยด์ทำมุม
 กัน 0 องศา77

4-37 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่
 อุณหภูมิ 34.0° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 โพลารอยด์ทำมุม
 กัน 90 องศา77

4-38 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่อุณหภูมิ
 34.0° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ไม่มีโพลาริเซอร์78

4-39 เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของ MBBA/CA $0.391 \pm 0.012\%$ ที่อุณหภูมิ 44.3° ซ
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์อยู่ที่ตำแหน่ง
 0 องศา79

4-40 เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของ MBBA/CA $0.391 \pm 0.012\%$ ที่อุณหภูมิ 44.3° ซ
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์อยู่ที่ตำแหน่ง
 90 องศา79

4-41 เทกซ์เจอร์ลายกันหอยของ MBBA/CA $0.391 \pm 0.012\%$ ที่อุณหภูมิ 44.3° ซ
 ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สไลด์อยู่ที่ตำแหน่ง
 0 องศา อีกครั้ง79

4-42 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่
 อุณหภูมิ 35.2° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ ..80

4-43 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่
 อุณหภูมิ 35.3° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .80

4-44 เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene $0.589 \pm 0.004\%$ ที่
 อุณหภูมิ 35.4° ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .81

รูปที่	หน้า
4-45	เทกซ์เจอร์ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CP/Toluene 0.589±0.004% ที่ อุณหภูมิ 35.5°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .81
4-46	กราฟของอุณหภูมิกับขนาดของพิทช์วัดตำแหน่งที่ 1 ของรูปที่4-42 ถึง4-4583
4-47	กราฟของอุณหภูมิกับขนาดของพิทช์วัดตำแหน่งที่ 2 ของรูปที่4-42 ถึง4-4584
4-48	กราฟของอุณหภูมิกับขนาดของพิทช์วัดตำแหน่งที่ 3 ของรูปที่4-42 ถึง4-4585
4-49	เทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CP/Toluene 0.589±0.004% ที่ อุณหภูมิ 37.7°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .86
4-50	เทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CP/Toluene 0.589±0.004% ที่ อุณหภูมิ 37.8°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .86
4-51	เทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CP/Toluene 0.589±0.004% ที่ อุณหภูมิ 37.9°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ .87
4-52	ซลิเรนเทกซ์เจอร์ของเทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CP/Toluene 0.589±0.004% ที่อุณหภูมิ 38.8°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์88
4-53	ซลิเรนเทกซ์เจอร์ของเทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CP/Toluene 0.589±0.004% ที่อุณหภูมิ 38.9°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์89
4-54	ซลิเรนเทกซ์เจอร์ของเทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CP 1.06±0.01% ที่อุณหภูมิ 40.6°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ 90
4-55	ซลิเรนเทกซ์เจอร์ของเทกซ์เจอร์ลายกันหยอของ MBBA/CA 0.391±0.012% ที่อุณหภูมิ 39.3°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ 90
4-56	เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CP/Toluene 1.804±0.014% ที่อุณหภูมิ 36.0°ซ ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ เกิดสเฟียรูไลท์เล็กๆ มากมายในเทกซ์เจอร์คล้ายลายกันหยอ92

รูปที่	หน้า
4-57	เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CP/Toluene 1.804 ± 0.014% ที่อุณหภูมิ 35.8 °ซ สไลด์เดียวกับรูปที่ 4-56 สเฟียรูไลต์คอปเปอร์ไคซีน93
4-58	เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CP/Toluene 1.804 ± 0.014% สไลด์เดียวกับ รูปที่ 4-56 เมื่ออุณหภูมิลดลงมาจนถึงอุณหภูมิห้อง93
4-59	การเกิดบริเวณผลึกเหลวส่วนใหญ่ที่อุณหภูมิ 36.1 °ซ ของสไลด์ที่ให้เทกซ์เจอร์ ลายพิมพ์นิ้วมือของ MBBA/CN 1.061 ± 0.015% ความหนา 25 ไมครอน กำลัง ขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์ สเฟียรูไลต์เตรียมจะรวมกันเองหรือรวมกับบริเวณ ผลึกเหลวส่วนใหญ่94
4-60	เทกซ์เจอร์ของ MBBA/CA 0.8591 ± 0.0001% ที่อุณหภูมิห้อง หลังจาก สเฟียรูไลต์รวมกันแล้ว95
4-61	สเฟียรูไลต์ของ MBBA/CA 0.8591 ± 0.0001% ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ เวลา 8.37 น. ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์95
4-62	สเฟียรูไลต์ในรูปที่ 4-61 ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ เวลา 8.47 น.96
4-63	สเฟียรูไลต์ในรูปที่ 4-61 ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ เวลา 8.57 น. สเฟียรูไลต์เล็กพร้อมกับ สเฟียรูไลต์ใหญ่แล้ว96
4-64	สเฟียรูไลต์ในรูปที่ 4-61 ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ สเฟียรูไลต์ใหญ่เข้าร่วมกับบริเวณ ผลึกเหลวส่วนใหญ่97
4-65	สเฟียรูไลต์ของ MBBA/CA 0.8591 ± 0.0001% ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ เวลา 9.08 น. ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์97
4-66	สเฟียรูไลต์ในรูปที่ 4-65 ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ เวลา 9.18 น.98
4-67	สเฟียรูไลต์ในรูปที่ 4-65 ที่อุณหภูมิ 32.5 °ซ รวมกับบริเวณผลึกเหลวส่วนใหญ่แล้ว .98
4-68	สเฟียรูไลต์ของ MBBA/CA 0.8591 ± 0.0001% ที่อุณหภูมิ 33.3 °ซ เวลา 14.20 น. ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยด์99
4-69	สเฟียรูไลต์ในรูปที่ 4-68 ที่อุณหภูมิ 33.3 °ซ เวลา 14.26 น.99

รูปที่	หน้า
4-70 สเปียร์ไลท์ในรูปที่4-68 ที่อุณหภูมิ 33.3°ซ สัมผัสกัน แกนของอีลิกชานกัน	100
4-71 สเปียร์ไลท์ของ MBBA/CA 0.8591±0.0001% ที่อุณหภูมิ 33.3°ซ เวลา 13.57 น. ความหนา 25 ไมครอน กำลังขยาย 10X20 ครอสโพลารอยค์ แกนของอีลิกตั้งฉากกับแกนของอีลิกของบริ เวณผลึกเหลวส่วนใหญ่	100
4-72 สเปียร์ไลท์ในรูปที่4-71 ที่อุณหภูมิ 33.3°ซ เวลา 14.08 น.	101
4-73 สเปียร์ไลท์ในรูปที่4-71 ที่อุณหภูมิ33.3°ซ สัมผัสขอบเขตของบริ เวณผลึกเหลวส่วนใหญ่แล้วรวมไปเฉยๆโดยแกนของอีลิกไม่ชานกัน	101
4-74 กราฟของระยะระหว่างขอบของสเปียร์ไลท์และขอบเขตของบริ เวณผลึกเหลว ส่วนใหญ่กับเวลา ของรูปที่4-61 ถึง4-63	102
4-75 กราฟของระยะระหว่างขอบของสเปียร์ไลท์และขอบเขตของบริ เวณผลึกเหลว ส่วนใหญ่กับเวลา ของรูปที่4-65 ถึง4-66	103
4-76 กราฟของระยะระหว่างขอบของสเปียร์ไลท์และขอบเขตของบริ เวณผลึกเหลว ส่วนใหญ่กับเวลา ของรูปที่4-68 ถึง4-70	104
4-77 กราฟของระยะระหว่างขอบของสเปียร์ไลท์และขอบเขตของบริ เวณผลึกเหลว ส่วนใหญ่กับเวลา ของรูปที่4-71 ถึง4-73	105
5-1 กราฟของ (ร้อยละโดยน้ำหนักของ CA) ¹ กับขนาดของพิทซ์	111
5-2 กราฟของ (ร้อยละโดยน้ำหนักของ CN) ¹ กับขนาดของพิทซ์	112
5-3 กราฟของ (ร้อยละโดยน้ำหนักของ CP) ¹ กับขนาดของพิทซ์	113
5-4 แสงโพลาไรซ์อย่างเชิงเส้นซึ่งมีเวกเตอร์ทางไฟฟ้าเป็นแบบ A และ B ผ่านผลึกเหลวชนิดคอลเลสเทอร์ริกที่ทิศทางการเรียงตัวของโมเลกุลบิดตัวจากระนาบของคอลเลสเทอร์ริกหนึ่งไปยังระนาบที่อยู่ถัดๆไปจนครบ 1 คาบ แล้วบิดตัวซ้ำแบบเดิม .	119